

引用信息: Qian Daosun; Yang Lei. Acta Phys. -Chim. Sin., 1986, 2(05): 444-451 [钱道
荪; 杨镭. 物理化学学报, 1986, 2(05): 444-451]

本期目录 | 在线预览 | 过刊浏览 | 高级检索

[打印本页] [关闭]

研究论文

Ru^{3+} 及其它阳离子表面吸附对 $n\text{-InP}$ 光电化学性能的影响

钱道荪; 杨镭

上海交通大学应用化学系

摘要:

应用光阳极极化曲线, 电流-光强曲线、光谱响应曲线、平带电位以及电流相对增加与吸附时间之间的关系曲线研究了 Ru^{3+} 表面吸附对 $n\text{-InP}$ 光电化学性能的影响, 还研究了其它一些阳离子吸附的影响。

关键词:

收稿日期 1985-06-10 修回日期 1986-04-14 网络版发布日期 1986-10-15

通讯作者: Email:

本刊中的类似文章

Copyright © 物理化学学报

扩展功能

本文信息

[PDF\(2276KB\)](#)

服务与反馈

[把本文推荐给朋友](#)

[加入我的书架](#)

[加入引用管理器](#)

[引用本文](#)

[Email Alert](#)

[文章反馈](#)

[浏览反馈信息](#)

[本文关键词相关文章](#)

[本文作者相关文章](#)

▶ [钱道荪](#)

▶ [杨镭](#)